(19)日本国特許庁（ＪＰ） (12)公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開平5－250636

(43)公開日 平成5年(1993)9月28日

(51)Int.Cl.[5]	識別記号	庁内整理番号	ＦＩ	技術表示箇所
Ｇ１１Ｂ 5/31		Ｆ 7247－5Ｄ		
		Ｇ 7247－5Ｄ		

審査請求 未請求 請求項の数5(全 11 頁)

(21)出願番号 特願平4－46572

(22)出願日 平成4年(1992)3月4日

(71)出願人 000005083
日立金属株式会社
東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

(72)発明者 武田 茂
埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式会社磁性材料研究所内

(72)発明者 伊藤 親市
埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式会社磁性材料研究所内

(72)発明者 川井 哲郎
埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式会社磁性材料研究所内

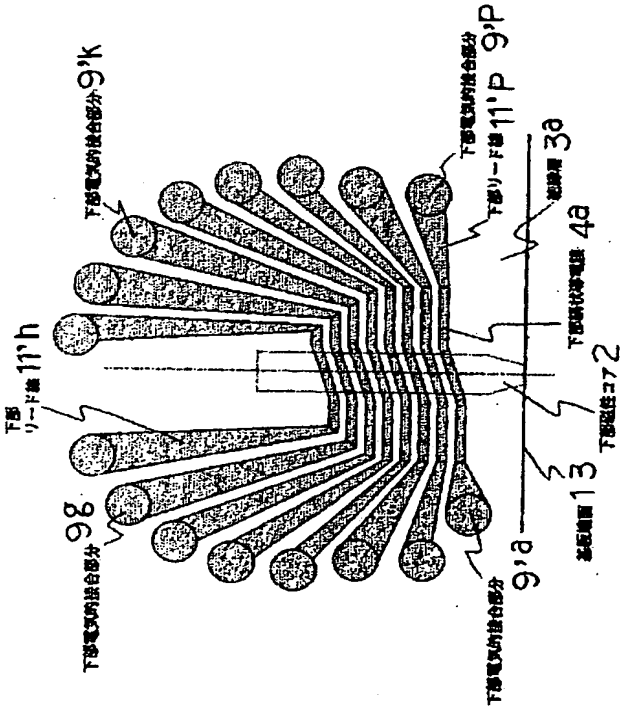
(74)代理人 弁理士 大場 充

(54)【発明の名称】 薄膜磁気ヘッド

(57)【要約】

【目的】 量産に適し、信頼性の高い薄膜磁気ヘッドを得る

【構成】 基板１上に下部磁性コアを被着形成し、下部磁性コアの上に絶縁層２ａを介して下部縞状導電膜６を形成し、下部縞状導電膜６の上に絶縁層２ｂを介して上部磁性コア４を形成し、上部磁性コア４の上に絶縁層３ａを介して上部縞状導電膜７を形成し、下部縞状導電膜６及び上部縞状導電膜７の端部は連結されてヘリカル状導体コイルが形成される薄膜磁気ヘッドであって、下部縞状導電膜６と前記上部縞状導電膜７を電気的に連結する電気的接合部分の幅が上部及び下部の縞状導電膜６，７の磁性コア４に重なる部分の幅より大きい薄膜磁気ヘッド。



【特許請求の範囲】

【請求項１】　基板上に下部磁性コアを被着形成し、前記下部磁性コアの上に絶縁層を介して下部縞状導電膜を形成し、前記下部縞状導電膜の上に絶縁層を介して上部磁性コアを形成し、前記上部磁性コアの上に絶縁層を介して上部縞状導電膜を形成し、前記下部縞状導電膜及び上部縞状導電膜の端部は連結されてヘリカル状導体コイルが形成される薄膜磁気ヘッドにおいて、前記下部縞状導電膜と前記上部縞状導電膜を電気的に連結する電気的接合部分の幅が前記上部及び下部の縞状導電膜の磁性コアに重なる部分の幅より大きいことを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【請求項２】　基板上に下部縞状導電膜を被着形成し、前記下部縞状導電膜の上に絶縁層を介して下部磁性コアを形成し、前記下部磁性コアの上に絶縁層を介して上部縞状導電膜を形成し、前記上部縞状導電膜の上に絶縁層を介して上部磁性コアを形成し、前記下部縞状導電膜及び上部縞状導電膜の端部は連結されてヘリカル状導体コイルが形成される薄膜磁気ヘッドにおいて、前記下部縞状導電膜と前記上部縞状導電膜を電気的に連結する電気的接合部分の幅が前記上部及び下部の縞状導電膜の磁性コアに重なる部分の幅より大きいことを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【請求項３】　請求項１あるいは請求項２において、前記電気的接合部分は下部及び上部リード線により前記上部及び下部の縞状導電膜に連結されていることを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【請求項４】　請求項３において、前記下部及び上部リード線の幅が前記上部及び下部の縞状導電膜の磁性コアに重なる部分の幅より大きいことを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【請求項５】　請求項３あるいは請求項４において、前記下部リード線及び上部リード線は絶縁層を介して重なるように配されていることを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は構造が簡単で製造し易い高性能な薄膜磁気ヘッドに関する。

【０００２】

【従来の技術】従来、薄膜磁気ヘッドは、基板上に薄膜堆積法、フォトリソグラフィ技術等を用いて磁性コア、導体コイルを絶縁層を介して形成するものであり、従来のバルク型のヘッドに比べて小型化、高性能化が容易である。従来の薄膜磁気ヘッドは、図７に示すように、下部磁性コア(4′)上に絶縁層(3′a)を介してスパイラル状導体コイル(12′)が被着形成されており、該導体コイル上に絶縁層(3′b)を介して上部磁性コア(6′)が被着形成されている。上述のようなスパイラル状導体コイル(12′)を有する薄膜磁気ヘッドは、製造が容易であるが、導体コイルの占める面積が大きくなり、ヘッドを組み立てる際には、小型実装の面で不利である。また、スパイラル状導体コイル(12′)に流れる電流から発生する磁束は、下部及び上部の磁性コア(4′)(6′)の高透磁率性を利用することによりｙ方向の成分となりヘッドギャップ(5′)に導かれる。しかし、このときのコイルによる磁界は、図７のHxに示すように、反磁界の大きい磁性コアの膜面に垂直なｘ方向であり、磁性コアを飽和まで到達させるにはかなり大きな起磁力が必要である。さらに、スパイラル状導体(12′)と磁性コア(4′)(6′)の重なっている部分の面積比率がきわめて少なく、導体コイルと磁性コアの結合状態という点から見れば、図７の従来のスパイラル状導体コイルの構造は好ましい構造ではない。これに対して、図８に示されているようなヘリカル状導体コイル(7″)を有する薄膜磁気ヘッドでは、導体コイルの占める面積が小さく、小型実装に適している。また、ヘリカル状の導体コイル(7″)に流れる電流から発生する磁界は、図８のHyに示すように、反磁界の小さい上部磁性コア(6″)の膜面内のｙ方向を向いており、小さい起磁力で磁気記録に充分な磁界をヘッドギャップ(5′)に発生させることができる。さらに、ヘリカル状導体コイルではコイルと磁性コアの重なる部分の面積比率がきわめて大きく、両者の結合効率がきわめて高いという大きな利点を持っている。しかし、１ターンの導体コイルを形成するのに、導体層の形成、エッチングによる形状加工、絶縁層の形成、スルーホール加工という複雑な工程が必要であること、多数巻の導体コイルを作製する場合、図８の電気的接合部分(9″)に示すように面積の小さい接続箇所が多くなり、信頼性の面でも問題があることが欠点とされてきた。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記従来例の欠点に鑑みなされたものであり、量産性に適し、しかも信頼性の高い薄膜磁気ヘッドを提供することを目的とするものである。

【０００４】

【課題を解決するための手段】本発明は、基板上に下部磁性コアを被着形成し、前記下部磁性コアの上に絶縁層を介して下部縞状導電膜を形成し、前記下部縞状導電膜の上に絶縁層を介して上部磁性コアを形成し、前記上部磁性コアの上に絶縁層を介して上部縞状導電膜を形成し、前記下部縞状導電膜及び上部縞状導電膜の端部は連結されてヘリカル状導体コイルが形成される薄膜磁気ヘッドにおいて、前記下部縞状導電膜と前記上部縞状導電膜を電気的に連結する電気的接合部分の幅が前記上部及び下部の縞状導体膜の磁性コアに重なる部分の幅より大きいことを特徴としている。

【０００５】

【作用】上記構成によれば、図８の従来構造の電気的接合部分(9″)に比較して大きな面積で下部及び上部縞状導

電膜を電気的に接合できるので、量産性に適した信頼性の高い薄膜磁気ヘッドを実現できる。

【０００６】

【実施例】以下、図面を参照しつつ本発明の実施例を詳細に説明する。図１(a)は本発明の一つの実施例を示す薄膜磁気ヘッドの平面図、図１(b)は平面図(a)におけるA-A'線に沿った断面図、図１(c)は平面図(a)におけるB-B'断面図である。図中、(1)はMn-Znフェライトや Ni-Znフェライト等の強磁性酸化物材料、あるいは結晶化ガラス等の非磁性セラミックスからなる基板であり、該基板(1)の上面にはパーマロイ、センダスト、Co系アモルファス磁性合金等の高透磁率磁性薄膜よりなる下部磁性コア(2)が被着形成されている。前記下部磁性コアの上にはSiO_2等の絶縁材料よりなる絶縁層(3a)を介してCu、Al等の導電材料よりなる約２μm厚の下部縞状導電膜(4)が形成されている。該下部縞状導電膜(4)の上には約１μm厚の絶縁層(3b)が形成されている。前記の絶縁膜(3b)の上には高透磁率磁性薄膜よりなる上部磁性コア(5)が被着形成されている。前記上部磁性コア(5)は図に示すように、効率のよいヘッドギャップ(10)を形成するために、磁極の先端と磁性基板の間隔が狭くなるように作製されている。下部磁性コア(2)と上部磁性コア(5)の端面は基板(1)の端面と同一面に露出し、ヘッドギャップ(5)の磁極となっている。前記下部磁性コア(2)と上部磁性コア(5)の他方の端は、絶縁層(3)(6)の取り除かれた磁気的接合部分(12)により磁気的に接合されている。前記上部磁性コア(5)の上には約１μmの絶縁層(6a)を介して上部縞状導電膜(7)が形成されている。前記下部及び上部縞状導電膜(4)(7)は、上部磁性コア(5)を巻回するが、上部磁性コアの近傍ではお互いに端部は連結されず、下部及び上部リード線(11')(11)により上部及び下部磁性コアより離れた電気的接合部分(9)で連結されてヘリカル状導体コイルとなる。このような構造を採用することにより、電気的接合部分(9)は図８の従来構造に比較して幅にして４倍以上、面積で１６倍以上にとることができた。これにより、ヘリカル状導体コイルの歩留り及び薄膜磁気ヘッドの信頼性が飛躍的に向上した。また、下部リード線(11')と上部リード線(11)は全く同じ形状をしており、この二つの導体により発生する磁界はお互いに打ち消しあうのでリード線を遠方に伸ばしたことによるインダクタンスの増加は最低限に抑えることができた。次に、上記実施例の薄膜磁気ヘッドの製造方法について説明する。先ず、基板(1)の上面に下部磁性コア(2)が蒸着、スパッタリング及びフォトリソグラフィ等の技術により被着形成される。次に、前記下部磁性コア(2)を備えた基板(1)の上面に絶縁層(3a)を平坦に形成する。次に、図２に示すように、下部縞状導電膜(4a)～(4h)、下部リード線(11'a)～(11'p)、下部接合部分(9'a)～(9'p)が、蒸着、スパッタリング及びフォトリソグラフィ等の技術により被着形成される。この際、前記下部縞状導電膜(4)は、後工程で作製される上部縞状導電膜(7)と重なり、ヘリカル状導体コイルとなるように配されている。次に、前記下部縞状導電膜(4)、下部リード線(11')、下部接合部分(9')の上全域に絶縁層(3b)を平坦に形成する。次に、図３に示すように、エッチング加工によりスルーホール(14a)を作製し、前記下部磁気的接合部分(12)となる下部磁性コア(2)の表面を露出させる。また、効率のよいヘッドギャップを作製するための加工も行われる。次に、前記下部磁性コア(2)とほぼ同じ形状をした上部磁性コア(5)が蒸着、スパッタリング及びフォトリソグラフィ等の技術により被着形成される。下部及び上部磁性コアはこのプロセスおよび磁気的接合部分(12)で接合される。次に、前記上部磁性コア(5)を含む上面全域に絶縁層(3a)を平坦に形成する。次に、図４に示すように、エッチング加工によりスルーホール(14b)を作製し、前記下部電気的接合部分(9')を露出させる。次に、図５に示すように、上部縞状導電膜(7a)～(7h)、上部リード線(11a)～(11p)、上部電気的接合部分(9a)～(9p)、端子(8a)(8b)が、蒸着、スパッタリング及びフォトリソグラフィ等の技術により被着形成される。これにより、前記下部電気的接合部分(9')と前記上部電気的接合部分(9)は電気的に接合され、前記下部縞状導電膜(4)と前記上部縞上導電膜(7)は電気的につながり、ヘリカル状導体コイルとなる。次に、図１(b)(c)に示すように、保護のために全域表面に絶縁層(6b)を形成する。以上の工程により、本発明の一つの実施例が完成する。図６(a)は本発明のもう一つの実施例を示す薄膜磁気ヘッドの平面図、図６(b)は平面図(a)におけるA-A'線に沿った断面図、図６(c)は平面図(a)におけるB-B'断面図である。図中、(1)結晶化ガラス等の非磁性セラミックスからなる基板であり、該基板(1)の上面にはCu、Al等の導電材料よりなる約２μm厚の下部縞状導電膜(4)が形成されている。前記下部縞状導電膜(4)の上には、SiO_2等の絶縁材料よりなる絶縁層(3a)を介して、パーマロイ、センダスト、Co系アモルファス磁性合金等の高透磁率磁性薄膜よりなる下部磁性コア(2)が被着形成されている。前記下部磁性コアの上には約１μm厚の絶縁層(3b)が形成されている。前記絶縁層(3b)の上には上部縞状導電膜(7)が形成されている。該上部縞状導電膜(7)の上には前記の絶縁層(6a)を介して高透磁率磁性薄膜よりなる上部磁性コア(5)が被着形成されている。前記上部磁性コア(5)は図に示すように、効率のよいヘッドギャップ(10)を形成するために、磁極の先端と磁性基板の間隔が狭くなるように作製されている。下部磁性コア(2)と上部磁性コア(5)の端面は基板(1)の端面と同一面に露出し、ヘッドギャップ(10)の磁極となっている。前記下部磁性コア(2)と上部磁性コア(5)の他方の端は、絶縁層(3)(6)の取り除かれた磁気的接合部分(12)により磁気的に接合されている。図６の本実施例が図１の前実施例と異なる点は、前

記下部及び上部縞状導電膜(4)(7)が下部磁性コア(5)を巻回し、下部磁性コアの近傍ではお互いに端部は連結されず、下部及び上部リード線(11')(11)により上部及び下部磁性コアより離れた電気的接合部分(9)で連結されてヘリカル状導体コイルとなることである。このような構造を採用することにより、前の実施例と同じように、ヘリカル状導体コイルの歩留り及び薄膜磁気ヘッドの信頼性が飛躍的に向上した。この実施例は、本発明の請求の範囲の基礎的事項である、電気的接合部分及びリード線の幅が縞上導電膜の磁性コアに重なる部分の幅より大きいという事項を含んでいることから、本分野の専門家であれば上記実施例が本発明の範囲に含まれることは容易に理解できるであろう。

【０００７】

【発明の効果】本発明によれば、従来構造に比較し、製造が容易で量産性に適した高信頼性の薄膜磁気ヘッドを提供し得る。

【図面の簡単な説明】

【図１】薄膜磁気ヘッドの平面図及び断面図

【図２】薄膜磁気ヘッドの製造方法を示す平面図

【図３】薄膜磁気ヘッドの製造方法を示す平面図

【図４】薄膜磁気ヘッドの製造方法を示す平面図

【図５】薄膜磁気ヘッドの製造方法を示す平面図

【図６】薄膜磁気ヘッドの他の実施例を示す要部平面図

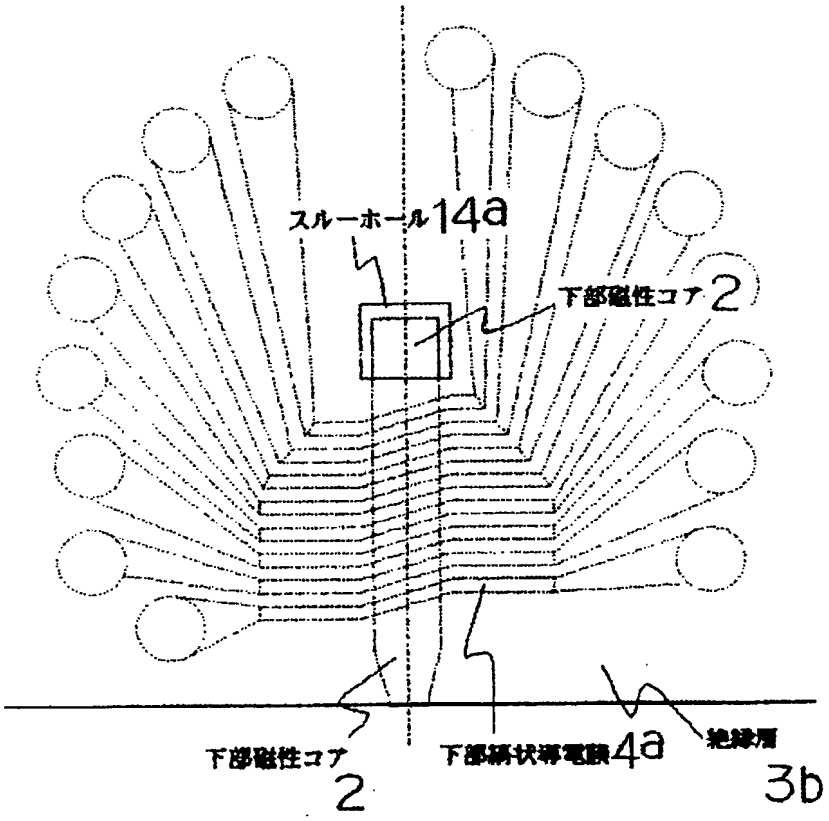
【図７】従来の薄膜ヘッドの平面図と断面図。

【図８】従来の薄膜ヘッドの平面図と断面図。

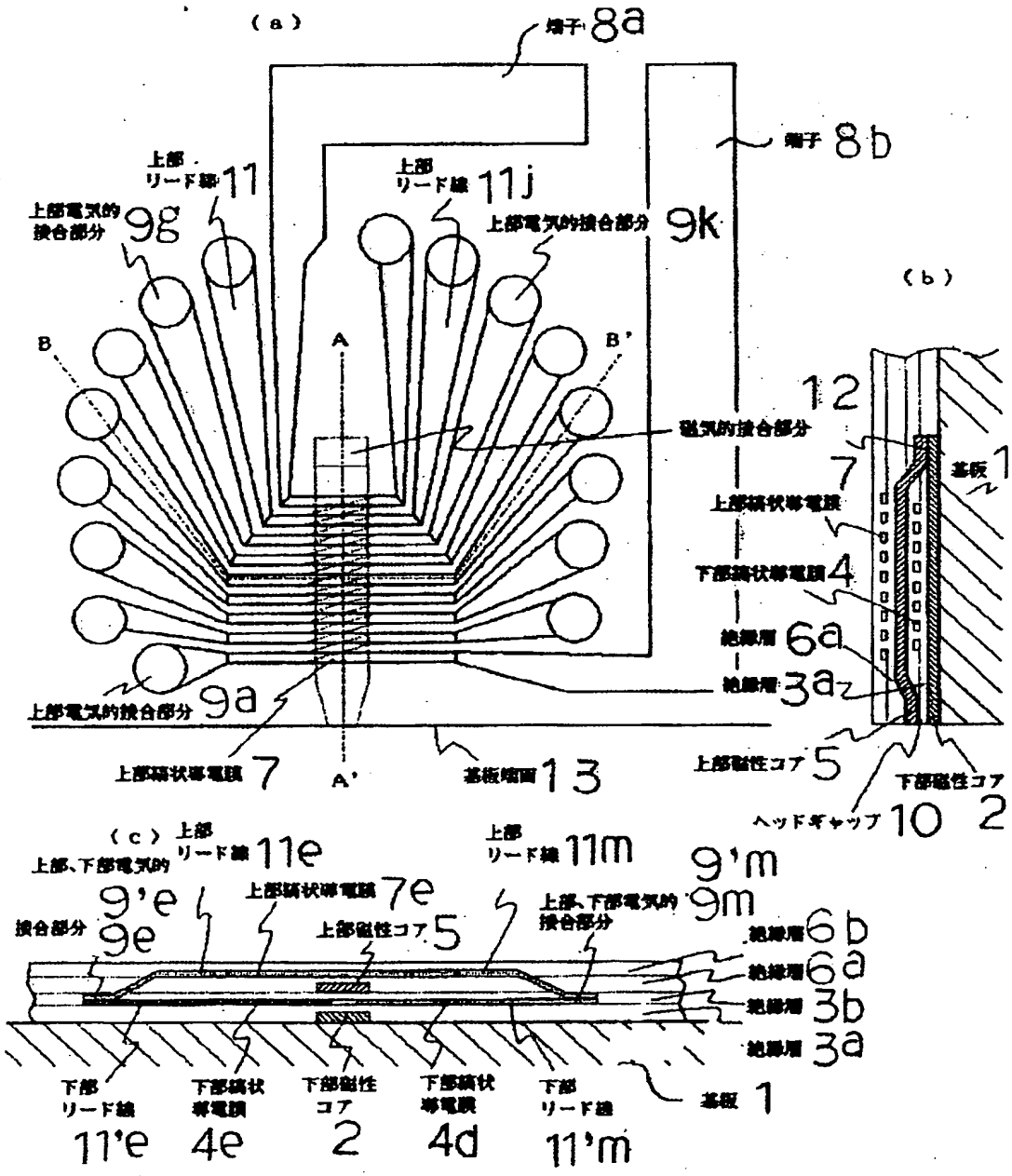
【符号の説明】

1　基板
2　下部磁性コア
3　絶縁層
4　下部縞状導電膜
5　上部磁性コア
6　絶縁層
7　上部縞状導電膜
7'　ヘリカル状導体コイル
8　端子
9　電気的接合部分
１０　ヘッドギャップ
１１　リード線
１２　磁気的接合部分
１２'　スパイラル状導体コイル
１３　基板端面
１４　スルーホール

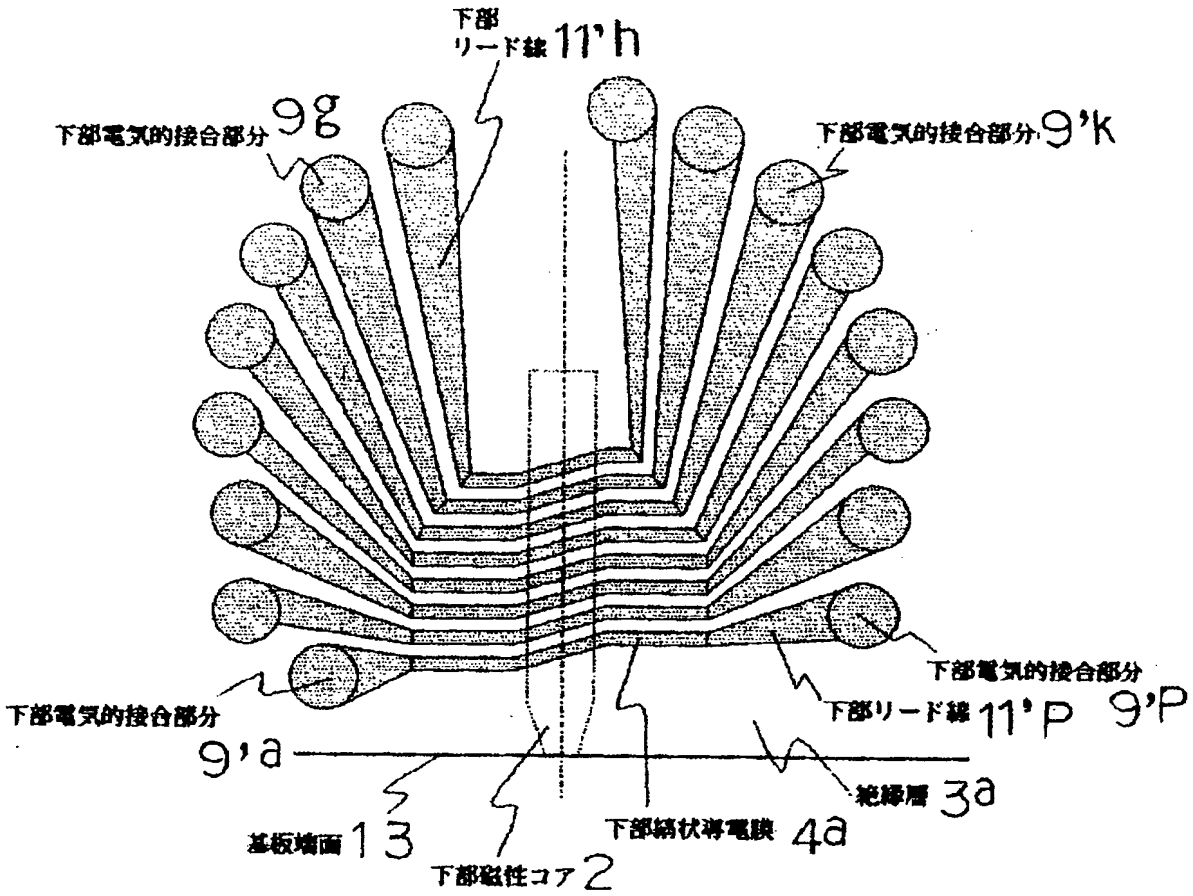
【図３】



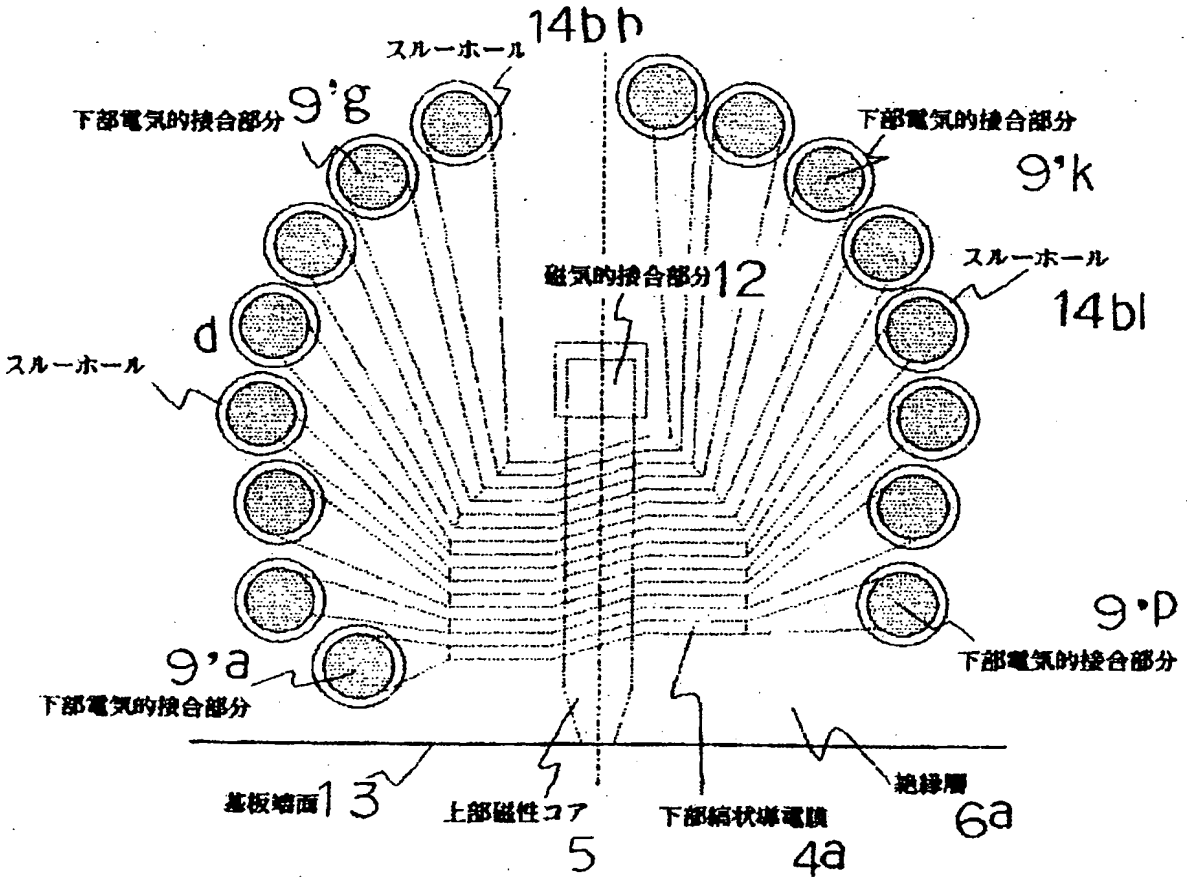
【図１】


（a）
端子 8a
端子 8b
上部リード線 11
上部リード線 11j
上部電気的接合部分 9g
上部電気的接合部分 9k
B
A
B'
磁気的接合部分
上部電気的接合部分 9a
上部薄状導電膜 7
A'
基板端面 13
（b）
12
7
基板 1
上部薄状導電膜
下部薄状導電膜 4
絶縁層 6a
絶縁層 3a
上部磁性コア 5
下部磁性コア
ヘッドギャップ 10
2
（c）
上部、下部電気的接合部分 9'e
上部リード線 11e
上部薄状導電膜 7e
上部磁性コア 5
上部リード線 11m
上部、下部電気的接合部分 9'm 9m
9e
絶縁層 6b
絶縁層 6a
絶縁層 3b
絶縁層 3a
基板 1
下部リード線 11'e
下部薄状導電膜 4e
下部磁性コア 2
下部薄状導電膜 4d
下部リード線 11'm

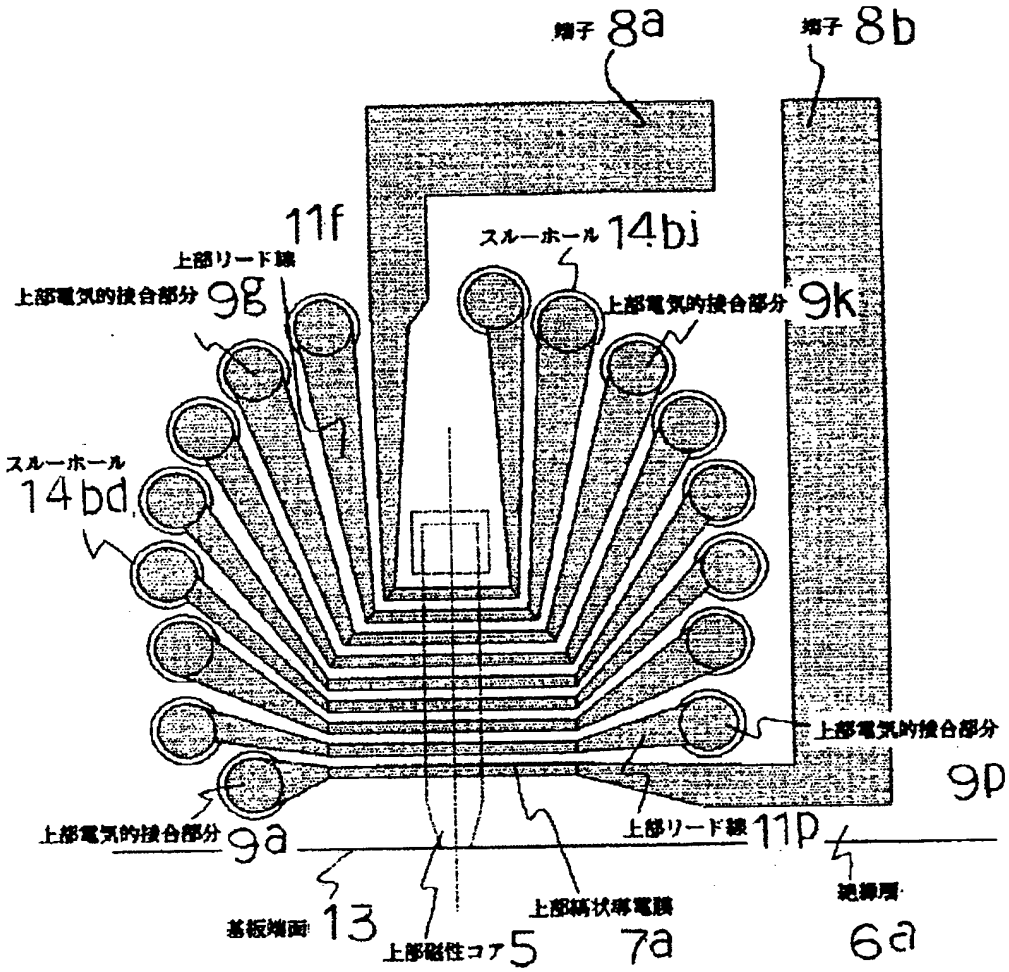
【図２】


下部
リード線 11'h
下部電気的接合部分 9g
下部電気的接合部分 9'k
下部電気的接合部分
下部電気的接合部分
下部リード線 11'P 9'P
9'a
絶縁層 3a
基板端面 13
下部磁性コア 2
下部導体状導電膜 4a

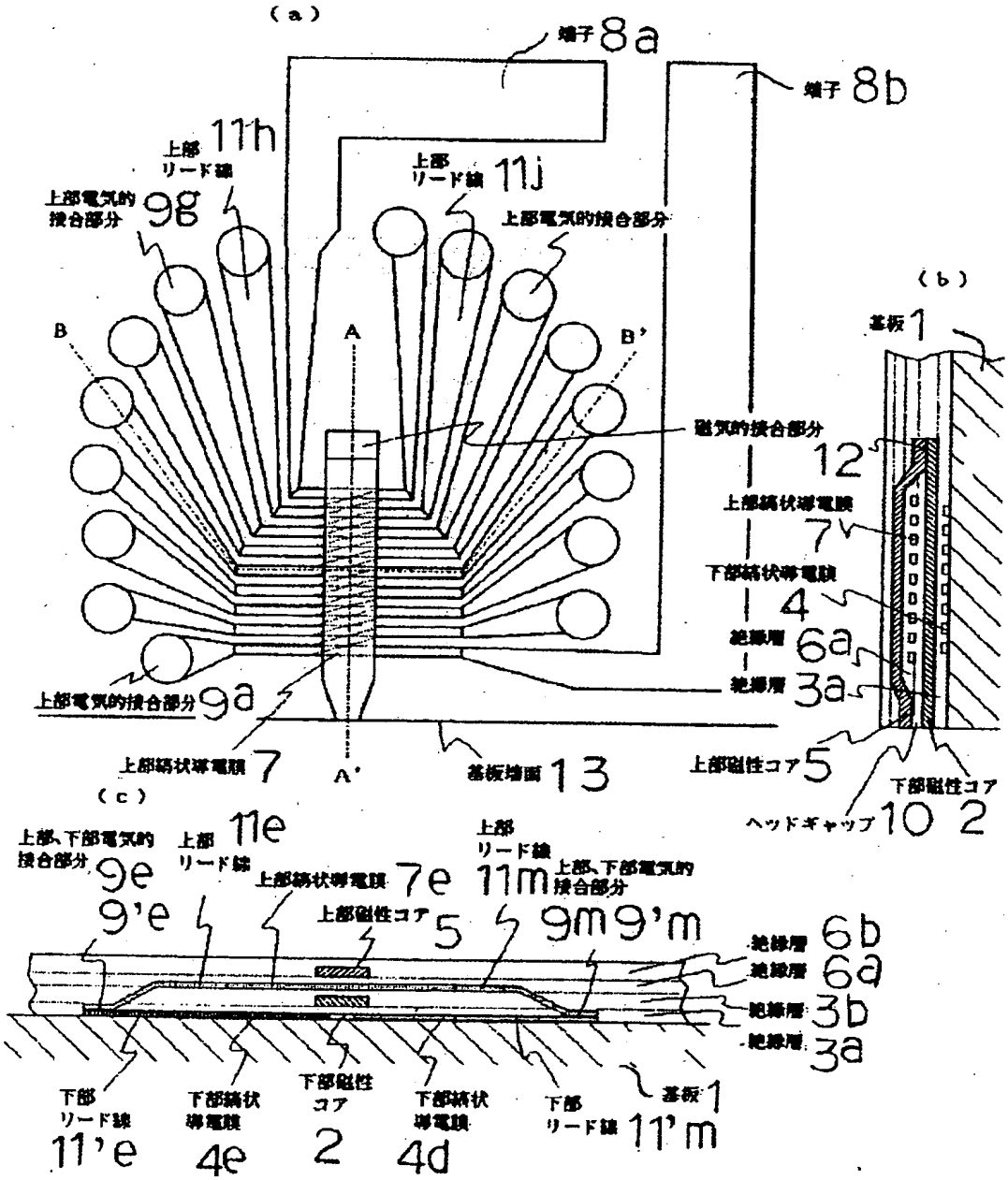
【図４】


14bh
スルーホール
下部電気的接合部分
9'g
下部電気的接合部分
9'k
磁気的接合部分12
スルーホール
14bl
d
スルーホール
9'a
下部電気的接合部分
9'p
下部電気的接合部分
基板境面13
上部磁性コア
5
下部線状導電膜
4a
絶縁層
6a

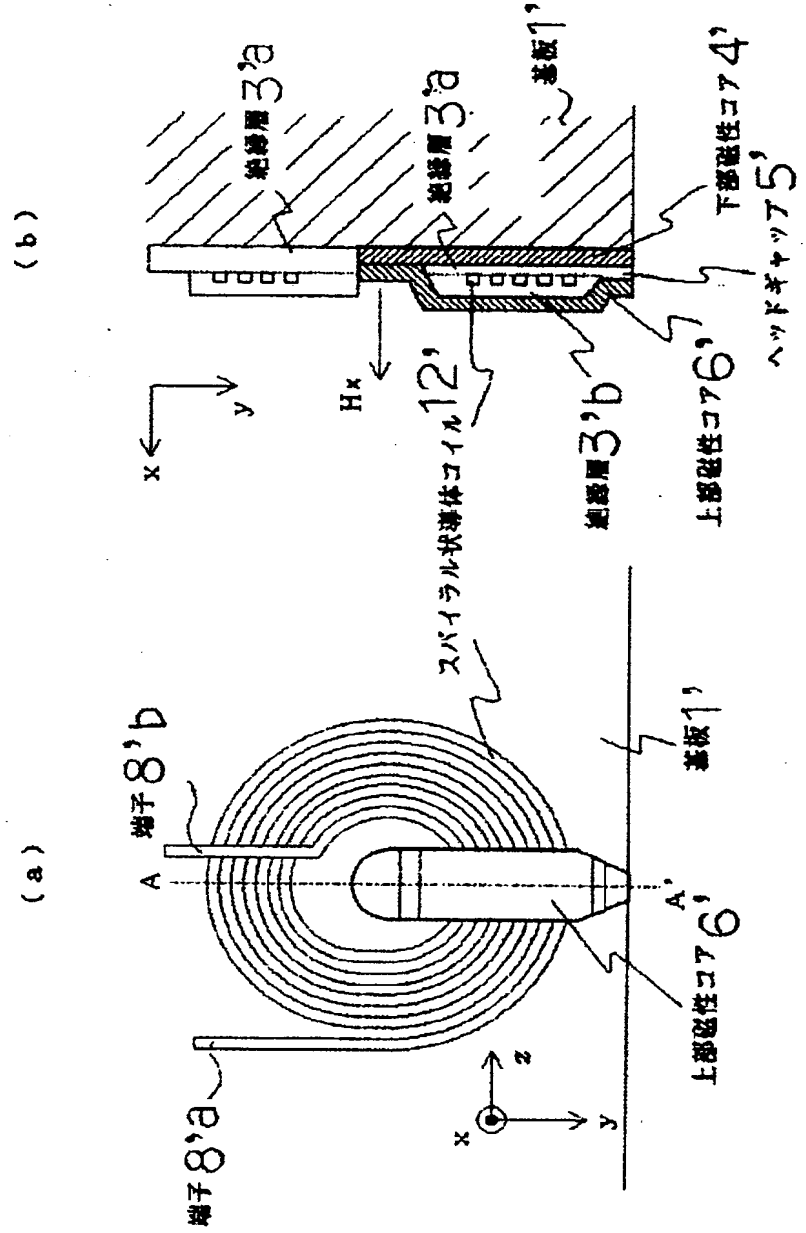
【図５】


端子 8a
端子 8b
11f
スルーホール 14bj
上部リード線
上部電気的接合部分 9g
上部電気的接合部分 9k
スルーホール
14bd
上部電気的接合部分
9p
上部電気的接合部分 9a
上部リード線 11p
基板端面 13
上部磁性コア 5
上部導体電極 7a
絶縁層
6a

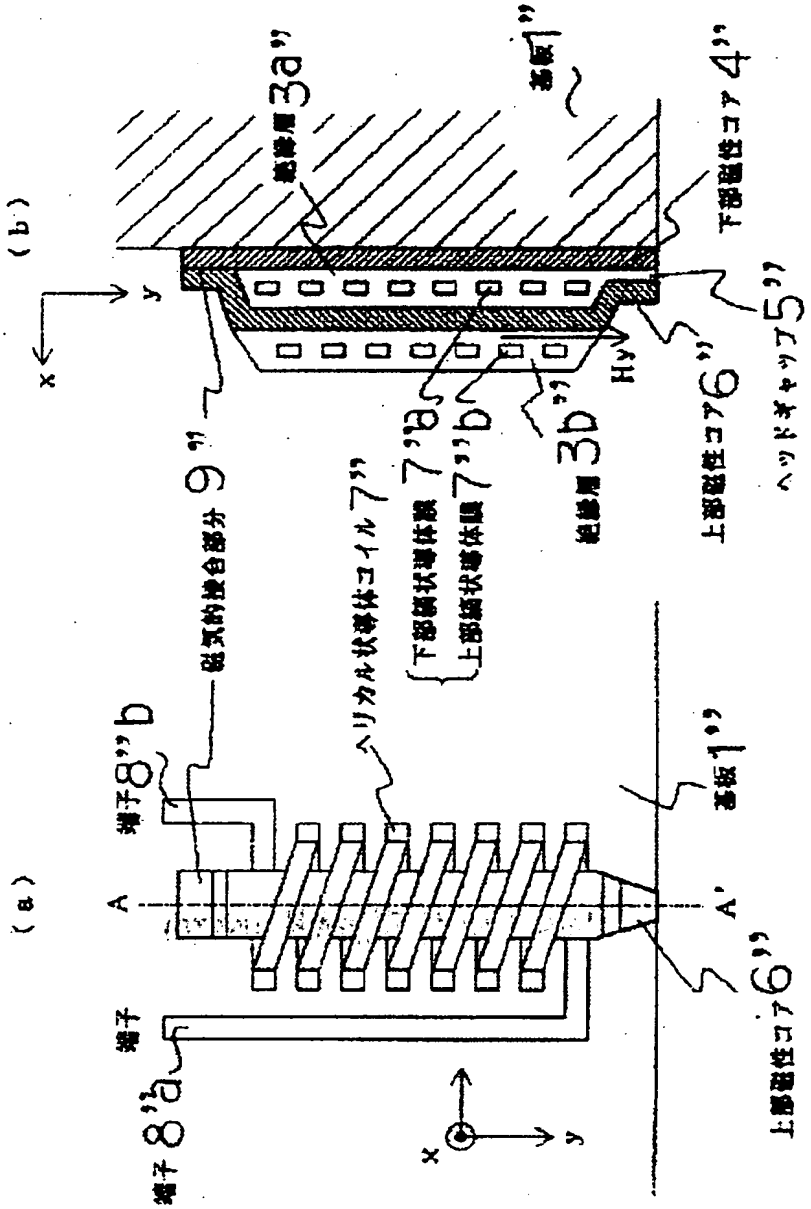
【図６】


（ａ）
端子 8a
端子 8b
上部 リード線 11h
上部 リード線 11j
上部電気的接合部分 9g
上部電気的接合部分
B
A
B'
磁気的接合部分 12
上部縞状導電膜 7
下部縞状導電膜 4
絶縁層 6a
絶縁層 3a
上部電気的接合部分 9a
上部縞状導電膜 7
A'
基板端面 13
上部磁性コア 5
下部磁性コア 2
ヘッドギャップ 10
（ｂ）
基板 1
（ｃ）
上部、下部電気的接合部分 9e
上部 リード線 11e
上部縞状導電膜 7e
上部 リード線 11m
上部、下部電気的接合部分 9m
9'e
9'm
上部磁性コア 5
絶縁層 6b
絶縁層 6a
絶縁層 3b
絶縁層 3a
下部 リード線 11'e
下部縞状導電膜 4e
下部磁性コア 2
下部縞状導電膜 4d
下部 リード線 11'm
基板 1

【図７】


(b)
絶縁層3'a
絶縁層3'a
基板1'
下部磁性コア4'
ヘッドギャップ5'
Hx
y
x
スパイラル状薄膜コイル12'
絶縁層3'b
上部磁性コア6'
(a)
端子8'b
A
A'
基板1'
スパイラル状薄膜コイル12'
上部磁性コア6'
z
x
y
端子8'a

【図８】


(b)
(a)
基板1''
絶縁層3a''
絶縁層3b''
下部磁性コア4''
ヘッドギャップ5''
上部磁性コア6''
上部磁性コア6'
ヘリカル状導体コイル7''
下部薄膜状導体膜7''a
上部薄膜状導体膜7''b
端子8''b
端子8''a
磁気的接合部分9''
Hy''
A
A'
x
y

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-250636
(43)Date of publication of application : 28.09.1993

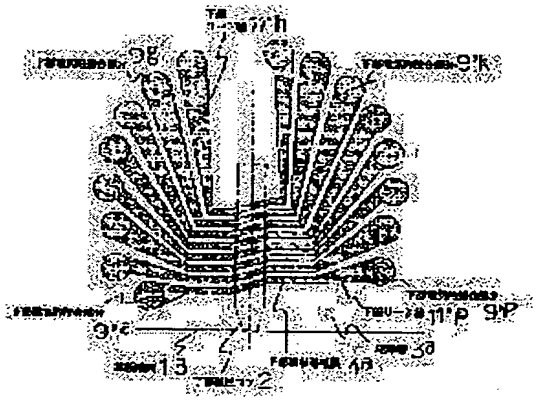
(51)Int.Cl. G11B 5/31

(21)Application number : 04-046572
(22)Date of filing : 04.03.1992

(71)Applicant : HITACHI METALS LTD
(72)Inventor : TAKEDA SHIGERU
ITO CHIKAICHI
KAWAI TETSUO

(54) THIN-FILM MAGNETIC HEAD

(57)Abstract:
PURPOSE: To obtain a thin-film magnetic head suitable for mass production and having high reliability.
CONSTITUTION: The thin-film magnetic head is produced by the. following process. A lower magnetic core 2 is formed by deposition on a substrate 1, on which an insulating layer 2a and a lower stripe conductive film 6 are formed. And an insulating layer 2a and an upper magnetic core 4, further an insulating layer 3a and an upper stripe conductive film 7 are formed thereon. The end part of the lower stripe conductive film 6 and the end of the upper stripe conductive film 7 are connected to form a helical conductive coil. The electric connecting part between the upper and lower stripe conductive films 6, 7 is made wider than the overlapping area of the upper and lower stripe conductive films on the magnetic core 4.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2.**** shows the word which can not be translated.
3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]
[Claim 1] Carry out covering formation of the lower magnetism core on a substrate, and the lower stripes-like electric conduction film is formed through an insulating layer on said lower magnetism core. Form an up magnetism core through an insulating layer on said lower stripes-like electric conduction film, and the up stripes-like electric conduction film is formed through an insulating layer on said up magnetism core. In the thin film magnetic head in which a coil is formed the edge of said lower stripes-like electric conduction film and the up stripes-like electric conduction film is connected — having — the shape of helical one — a conductor — The thin film magnetic head characterized by the width of face for the electric joint which connects electrically said lower stripes-like electric conduction film and said up stripes-like electric conduction film being larger than the width of face of the part which laps with the magnetic core of the stripes-like electric conduction film of said upper part and the lower part.
[Claim 2] Carry out covering formation of the lower stripes-like electric conduction film on a substrate, and a lower magnetism core is formed through an insulating layer on said lower stripes-like electric conduction film. Form the up stripes-like electric conduction film through an insulating layer on said lower magnetism core, and an up magnetism core is formed through an insulating layer on said up stripes-like electric conduction film. In the thin film magnetic head in which a coil is formed the edge of said lower stripes-like electric conduction film and the up stripes-like electric conduction film is connected — having — the shape of helical one — a conductor — The thin film magnetic head characterized by the width of face for the electric joint which connects electrically said lower stripes-like electric conduction film and said up stripes-like electric conduction film being larger than the width of face of the part which laps with the magnetic core of the stripes-like electric conduction film of said upper part and the lower part.
[Claim 3] It is the thin film magnetic head characterized by connecting a part for said electric joint with the stripes-like electric conduction film of said upper part and the lower part with the lower part and up lead wire in claim 1 or claim 2.
[Claim 4] The thin film magnetic head characterized by the width of face of said lower part and up lead wire being larger than the width of face of the part which laps with the magnetic core of the stripes-like electric conduction film of said upper part and the lower part in claim 3.
[Claim 5] It is the thin film magnetic head characterized by being allotted so that said lower lead wire and up lead wire may lap through an insulating layer in claim 3 or claim 4.

[Translation done.]

* NOTICES *

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2.**** shows the word which can not be translated.
3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]
[0001]
[Industrial Application] This invention relates to the highly efficient thin film magnetic head which structure is easy and is easy to manufacture.
[0002]
[Description of the Prior Art] the former and thin film magnetic head — a substrate top — the thin film depositing method, a photolithography technique, etc. — using — a magnetic core and a conductor — a coil is formed through an insulating layer and a miniaturization and high-performance-izing are easy compared with the head of the conventional bulk mold. the conventional thin film magnetic head is shown in drawing 7 — as — a lower magnetism core (4') top — an insulating layer (3'a) — minding — the shape of a spiral — a conductor — a coil (12') carries out covering formation — having — **** — this — a conductor — covering formation of the up magnetism core (6') is carried out through the insulating layer (3'b) on the coil. the shape of an above spiral — a conductor — although the thin film magnetic head which has a coil (12') is easy to manufacture — a conductor — in case the area which a coil occupies becomes large and assembles a head, it is disadvantageous in respect of small mounting. the shape of moreover, a spiral — a conductor — by using the high permeability nature of the magnetic core (4') (6') of the lower part and the upper part, the magnetic flux generated from the current which flows in a coil (12') serves as a component of the direction of y, and is led to a head gap (5'). However, as shown in Hx of drawing 7 , the fields with the coil at this time are x directions vertical to the film surface of the magnetic large core of an anti-field, and the quite big magnetomotive force to making a magnetic core reach to saturation is required for them. the shape of furthermore, a spiral — the rate of surface ratio of the part to which the magnetic core (4') (6') has lapped with the conductor (12') — very — few — a conductor — if it sees from the point of the integrated state of a coil and a magnetic core — the conventional shape of a spiral of drawing 7 — a conductor — the structure of a coil is not desirable structure. the shape of on the other hand, helical one as shown in drawing 8 — a conductor — the thin film magnetic head which has a coil (7″) — a conductor — the area which a coil occupies is small and it is suitable for small mounting. moreover, a helical conductor — the field generated from the current which flows in a coil (7″) has turned to the direction of y in the film surface of the small up magnetism core (6″) of an anti-field, and can make a head gap (5″) generate sufficient field for magnetic recording in small magnetomotive force, as shown in Hy of drawing 8 the shape of furthermore, helical one — a conductor — with the coil, the rate of surface ratio of the part to which a magnetic core laps with a coil is very large, and has the big advantage that both joint effectiveness is very high. however, the conductor of 1 turn — the conductor of that the complicated process of formation of a conductor layer, configuration processing by etching, formation of an insulating layer, and through hole processing is required although a coil is formed, and an a large number volume — when producing a coil, as shown in a part for the electric joint of drawing 8 (9″), the small connection place of area increased, and it has been made into a fault for there to be a problem also in respect of dependability.
[0003]
[Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention is made in view of the fault of the above-mentioned conventional example, and it is suitable for mass production nature, and aims at moreover offering the reliable thin film magnetic head.
[0004]
[Means for Solving the Problem] This invention carries out covering formation of the lower magnetism core on a substrate, and forms the lower stripes-like electric conduction film through an insulating layer on said lower magnetism core. Form an up magnetism core through an insulating layer on said lower stripes-like electric conduction film, and the up stripes-like electric conduction film is formed through an insulating layer on said up magnetism core. In the thin film magnetic head in which a coil is formed the edge of said lower stripes-like electric conduction film and the up stripes-like electric conduction film is connected — having — the shape of helical one — a conductor — the width of face for the electric joint which connects electrically said lower stripes-like electric conduction film and said up stripes-like electric conduction film — the shape of stripes of said upper part and the lower part — a conductor — it is characterized by being larger than the width of face of the part which laps with a membranous magnetic core.
[0005]
[Function] According to the above-mentioned configuration, since the lower part and the up stripes-like electric conduction film are electrically joinable in a big area as compared with a part for the electric joint of the

conventional structure of drawing 8 (9″), the thin film magnetic head with the high dependability suitable for mass production nature is realizable.

[0006]

[Example] Hereafter, the example of this invention is explained to a detail, referring to a drawing. The top view of the thin film magnetic head in which drawing 1 (a) shows one example of this invention, and drawing 1 (b) are the A-A'B-B [in / in the sectional view which met the line, and drawing 1 (c) / a top view (a)]' sectional views in a top view (a). Among drawing, (1) is a substrate which consists of nonmagnetic ceramics, such as ferromagnetic oxide ingredients, such as a Mn-Zn ferrite and a nickel-Zn ferrite, or glass ceramics, and covering formation of the lower magnetism core (2) which consists of high permeability magnetic thin films, such as a permalloy, Sendust, and Co system amorphous magnetism alloy, is carried out on the top face of this substrate (1). On said lower magnetism core, the lower stripes-like electric conduction film (4) of about 2-micrometer thickness which consists of electrical conducting materials, such as Cu and aluminum, through the insulating layer (3a) which consists of an insulating material of SiO2 grade is formed. On this lower stripes-like electric conduction film (4), the insulating layer (3b) of about 1-micrometer thickness is formed. On the aforementioned insulator layer (3b), covering formation of the up magnetism core (5) which consists of a high permeability magnetic thin film is carried out. As shown in drawing, in order to form an efficient head gap (10), said up magnetism core (5) is produced so that the head of a magnetic pole and spacing of a magnetic substrate may become narrow. It exposes to the same field as the end face of a substrate (1), and the end face of a lower magnetism core (2) and an up magnetism core (5) serves as a magnetic pole of a head gap (5). The other end of said lower magnetism core (2) and an up magnetism core (5) is magnetically joined by the amount of [by which an insulating layer (3) and (6) were removed] (12) magnetic joint. On said up magnetism core (5), the up stripes-like electric conduction film (7) is formed through about 1-micrometer insulating layer (6a). although said lower part and the up stripes-like electric conduction film (4), and (7) **** an up magnetism core (5), an edge is not connected with each other near the up magnetism core, but they are connected by part for the electric joint separated from the upper part and a lower magnetism core with the lower part and up lead wire (11') (11) (9) — having — the shape of helical one — a conductor — it becomes a coil. By adopting such structure, a part for an electric joint (9) was able to be made into width of face as compared with the conventional structure of drawing 8 , and was able to be taken to 16 or more times in 4 or more times and area. thereby — the shape of helical one — a conductor — the yield of a coil and the dependability of the thin film magnetic head improved by leaps and bounds. Moreover, lower lead wire (11') and up lead wire (11) were carrying out the completely same configuration, and since the field generated with these two conductors was negated to each other and suited him, the increment in the inductance by having lengthened lead wire far away was able to be suppressed to minimum. Next, the manufacture approach of the thin film magnetic head of the above-mentioned example is explained. First, covering formation of the lower magnetism core (2) is carried out by techniques, such as vacuum evaporationo, sputtering, and a photolithography, on the top face of a substrate (1). Next, an insulating layer (3a) is evenly formed in the top face of the substrate (1) equipped with said lower magnetism core (2). Next, as shown in drawing 2 , covering formation is carried out by techniques, such as a part for a lower stripes-like electric conduction film (4a) - (4h) lower lead-wire (11'a) - (11'p) lower joint - (9'p) (9'a), vacuum evaporationo, sputtering, and a photolithography. under the present circumstances, the up stripes-like electric conduction film (7) with which said lower stripes-like electric conduction film (4) is produced at an after process — lapping — the shape of helical one — a conductor — it is allotted so that it may become a coil. Next, an insulating layer (3b) is evenly formed throughout the top for said lower stripes-like electric conduction film (4), lower lead wire (11'), and a lower joint (9'). Next, as shown in drawing 3 , a through hole (14a) is produced by etching processing, and the front face of the lower magnetism core (2) used as a part for said lower magnetic joint (12) is exposed. Moreover, processing for producing an efficient head gap is also performed. Next, covering formation of the up magnetism core (5) which carried out the almost same configuration as said lower magnetism core (2) is carried out by techniques, such as vacuum evaporationo, sputtering, and a photolithography. The lower part and an up magnetism core are joined by part for this process and a magnetic joint (12). Next, an insulating layer (3a) is evenly formed throughout the top face containing said up magnetism core (5). Next, as shown in drawing 4 , a through hole (14b) is produced by etching processing, and a part for said lower electric joint (9') is exposed. Next, as shown in drawing 5 , covering formation of a part for an up stripes-like electric conduction film (7a) - (7h) up lead-wire (11a) - (11p) up electric joint - (9p) (9a) and the terminal (8a) (8b) is carried out by techniques, such as vacuum evaporationo, sputtering, and a photolithography. this joins electrically a part for a part for said lower electric joint (9'), and said up electric joint (9) — having — said lower stripes-like electric conduction film (4) and said electric conduction-on up stripes film (7) — electric — being connected — the shape of helical one — a conductor — it becomes a coil. Next, as shown in drawing 1 (b) and (c), an insulating layer (6b) is formed in a front face all over the districts for protection. One example of this invention is completed according to the above process. The top view of the thin film magnetic head in which drawing 6 (a) shows another example of this invention, and drawing 6 (b) are the A-A'B-B [in / in the sectional view which met the line, and drawing 6 (c) / a top view (a)]' sectional views in a top view (a). It is the substrate which consists of nonmagnetic ceramics, such as (1) glass ceramics, among drawing, and the lower stripes-like electric conduction film (4) of about 2-micrometer thickness which consists of electrical conducting materials, such as Cu and aluminum, is formed in the top face of this substrate (1). On said lower stripes-like electric conduction film (4), the insulating layer (3a) which consists of an insulating material of SiO2 grade is minded, and it is a permalloy, Covering formation of the lower magnetism core (2) which consists of high permeability magnetic thin films, such as Sendust and Co system amorphous magnetism alloy, is carried out. On said lower

magnetism core, the insulating layer (3b) of about 1-micrometer thickness is formed. On said insulating layer (3b), the up stripes-like electric conduction film (7) is formed. On this up stripes-like electric conduction film (7), covering formation of the up magnetism core (5) which consists of a high permeability magnetic thin film through the aforementioned insulating layer (6a) is carried out. As shown in drawing, in order to form an efficient head gap (10), said up magnetism core (5) is produced so that the head of a magnetic pole and spacing of a magnetic substrate may become narrow. It exposes to the same field as the end face of a substrate (1), and the end face of a lower magnetism core (2) and an up magnetism core (5) serves as a magnetic pole of a head gap (10). The other end of said lower magnetism core (2) and an up magnetism core (5) is magnetically joined by the amount of [by which an insulating layer (3) and (6) were removed] (12) magnetic joint. the point that this example of drawing 6 differs from the example before drawing 1 **** a lower magnetism core (5), and an edge is not connected with each other near the lower magnetism core, but said lower part and the up stripes-like electric conduction film (4), and (7) connect by part for the electric joint separated from the upper part and a lower magnetism core with the lower part and up lead wire (11') (11) (9) — having — the shape of helical one — a conductor — it is becoming a coil. adopting such structure — a front example — the same — the shape of helical one — a conductor — the yield of a coil and the dependability of the thin film magnetic head improved by leaps and bounds. Since the width of face of the part for an electric joint and lead wire which are the basic matters of the claim of this invention includes the matter of being larger than the width of face of the part which laps with the magnetic core of the electric conduction-on stripes film, if this example is the expert of this field, it will be able to understand it easily that the above-mentioned example is included in the range of this invention.

[0007]

[Effect of the Invention] According to this invention, as compared with structure, manufacture is conventionally easy, and the thin film magnetic head of the high-reliability suitable for mass production nature can be offered.

[Translation done.]

* NOTICES *

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2.**** shows the word which can not be translated.
3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]
[Drawing 1] The top view and sectional view of the thin film magnetic head
[Drawing 2] The top view showing the manufacture approach of the thin film magnetic head
[Drawing 3] The top view showing the manufacture approach of the thin film magnetic head
[Drawing 4] The top view showing the manufacture approach of the thin film magnetic head
[Drawing 5] The top view showing the manufacture approach of the thin film magnetic head
[Drawing 6] The important section top view showing other examples of the thin film magnetic head
[Drawing 7] The conventional top view and conventional sectional view of a thin film head.
[Drawing 8] The conventional top view and conventional sectional view of a thin film head.
[Description of Notations]
1 Substrate
2 Lower Magnetism Core
3 Insulating Layer
4 Lower Stripes-like Electric Conduction Film
5 Up Magnetism Core
6 Insulating Layer
7 Up Stripes-like Electric Conduction Film
7″ the shape of helical one — a conductor — coil
8 Terminal
9 A Part for Electric Joint
10 Head Gap
11 Lead Wire
12 A Part for Magnetic Joint
12' the shape of a spiral — a conductor — coil
13 Substrate End Face
14 Through Hole

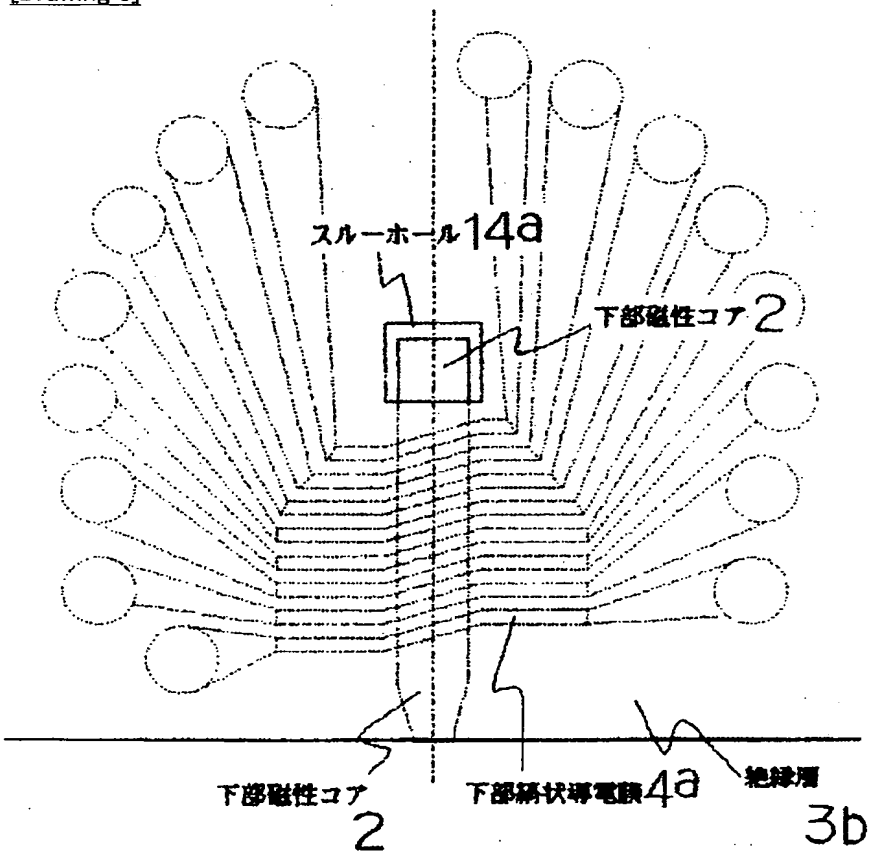
[Translation done.]

* NOTICES *

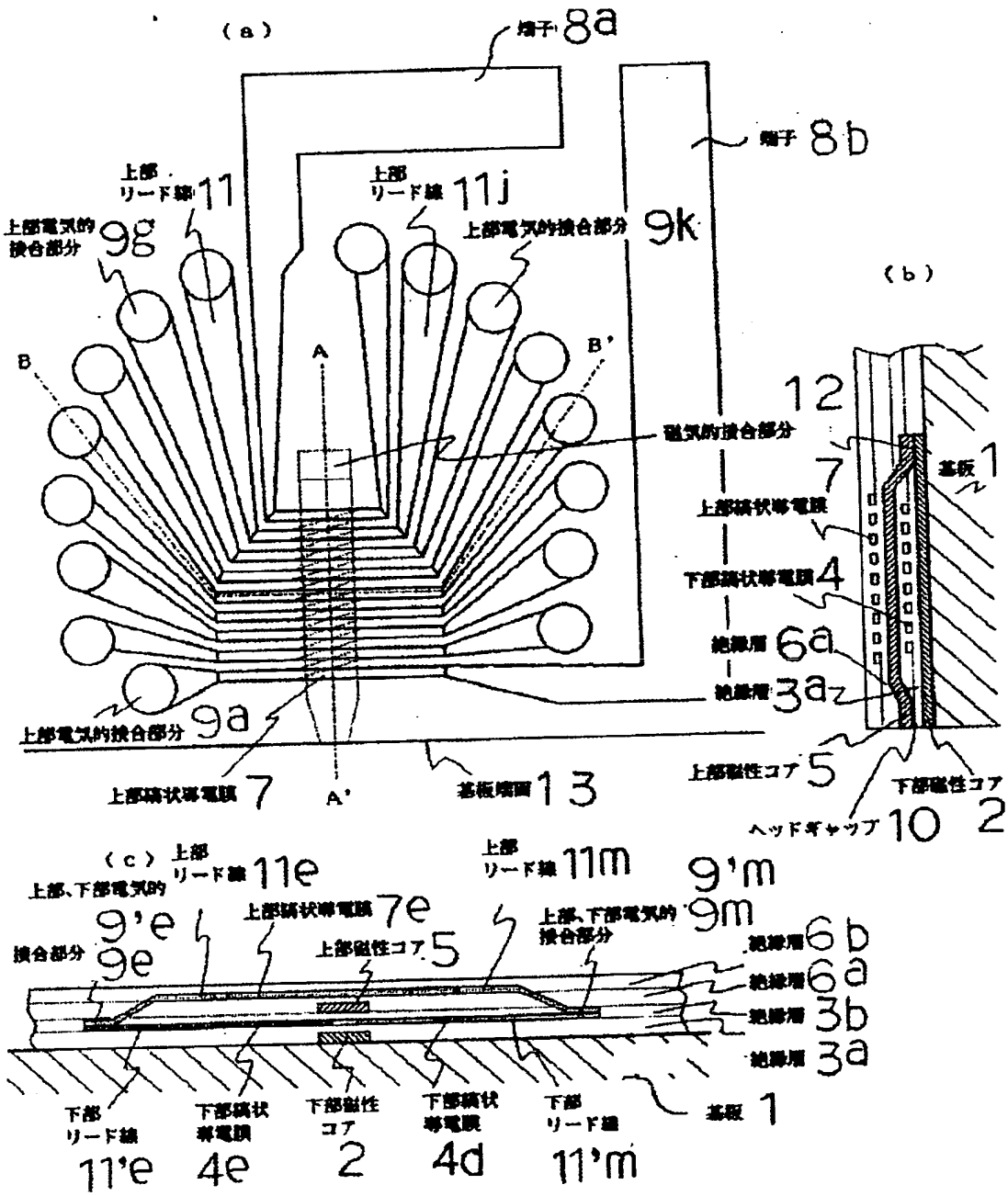
1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2.**** shows the word which can not be translated.
3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

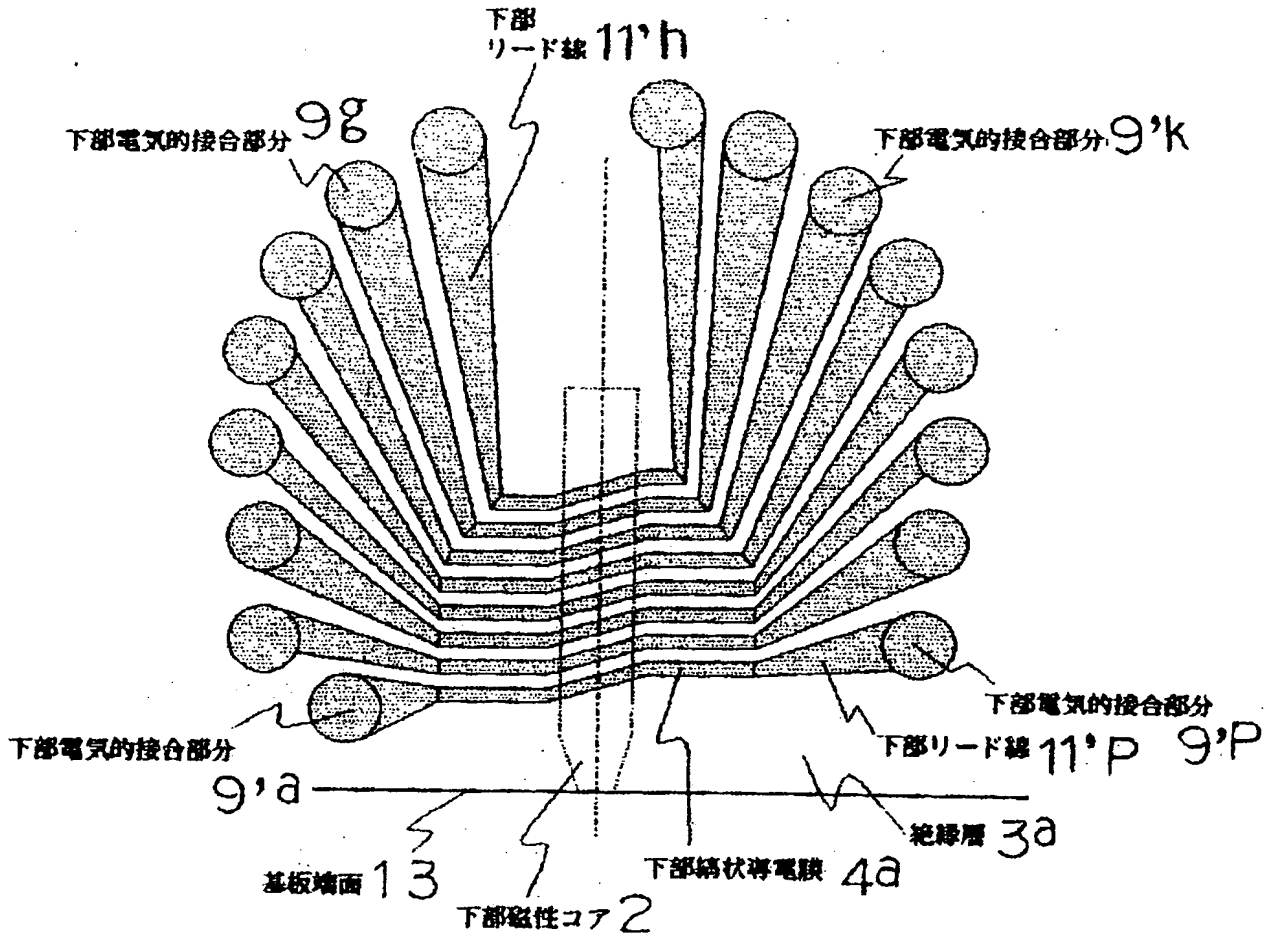
[Drawing 3]



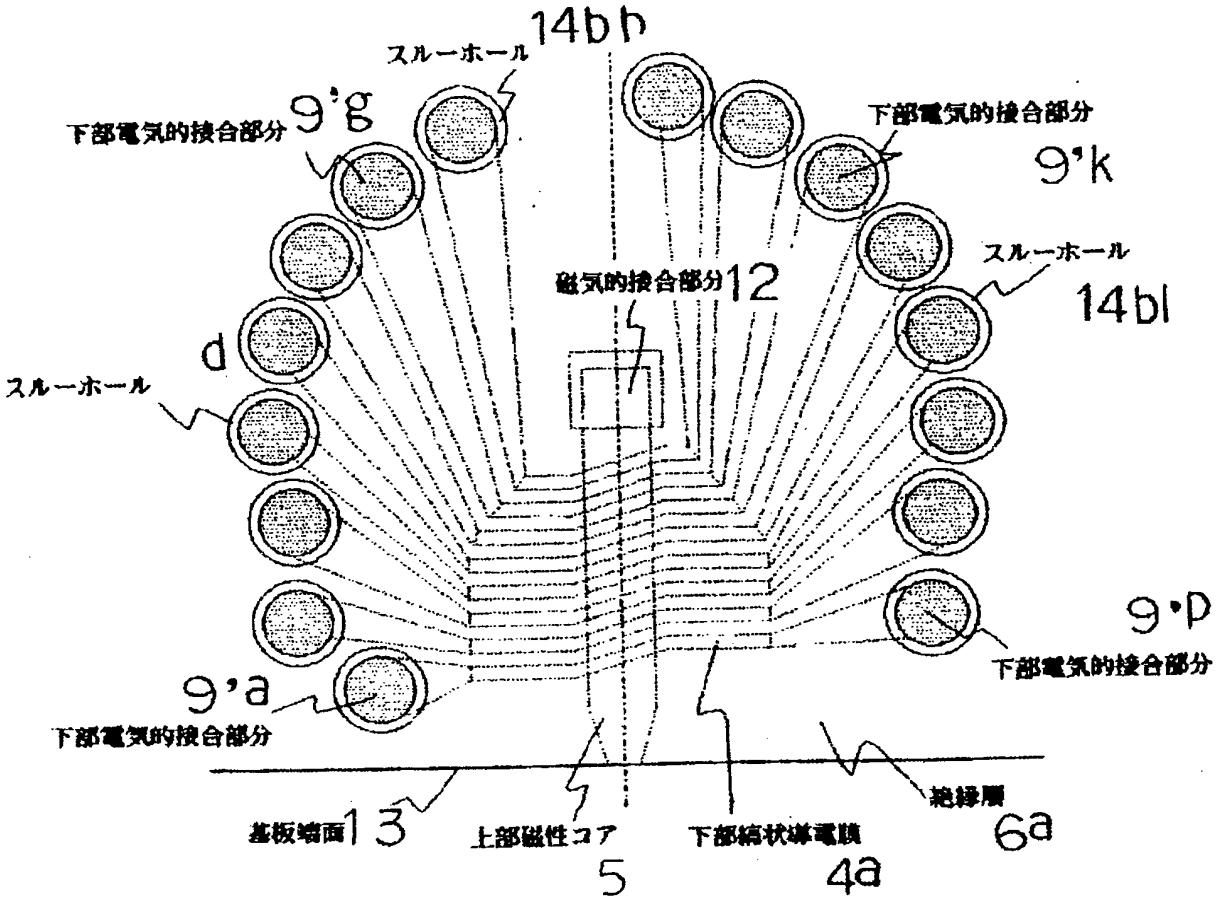
[Drawing 1]


(a)
端子 8a
端子 8b
上部リード線 11
上部リード線 11j
上部電気的接合部分 9g
上部電気的接合部分 9k
B
A
B'
磁気的接合部分
12
7
基板 1
上部磁性コア 5
下部磁性コア 2
ヘッドギャップ 10
上部電気的接合部分 9a
上部磁性コア 7
A'
基板端面 13
(b)
上部磁性導電膜
下部磁性導電膜 4
絶縁層 6a
絶縁層 3a
(c)
上部リード線 11e
上部リード線 11m
9'm
上部、下部電気的接合部分 9'e
上部磁性導電膜 7e
上部磁性コア 5
上部、下部電気的接合部分 9m
接合部分 9e
絶縁層 6b
絶縁層 6a
絶縁層 3b
絶縁層 3a
基板 1
下部リード線 11'e
下部磁性導電膜 4e
下部磁性コア 2
下部磁性導電膜 4d
下部リード線 11'm

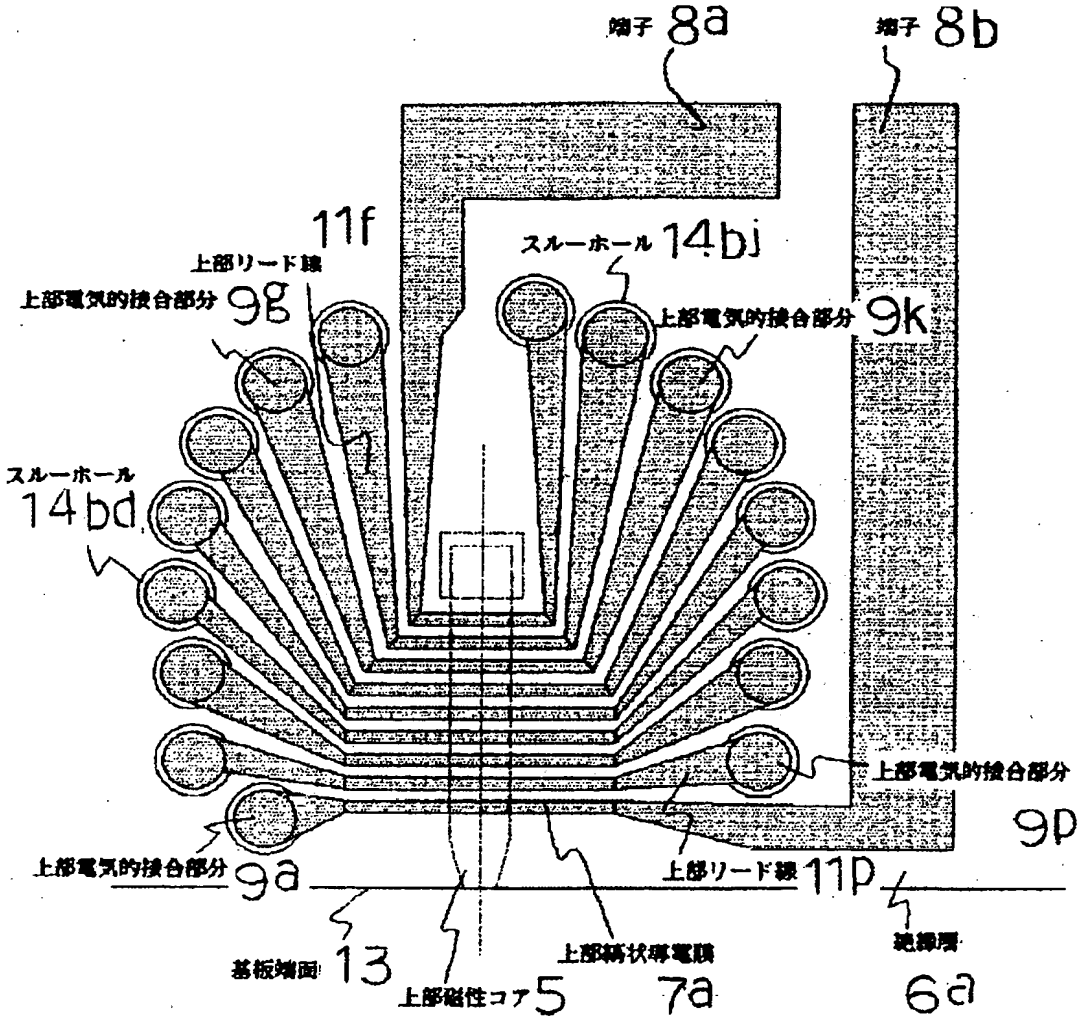
[Drawing 2]


下部
リード線 11'h
下部電気的接合部分 9g
下部電気的接合部分 9'k
下部電気的接合部分
下部電気的接合部分
下部リード線 11'P 9'P
9'a
絶縁層 3a
基板端面 13
下部導電膜 4a
下部磁性コア 2

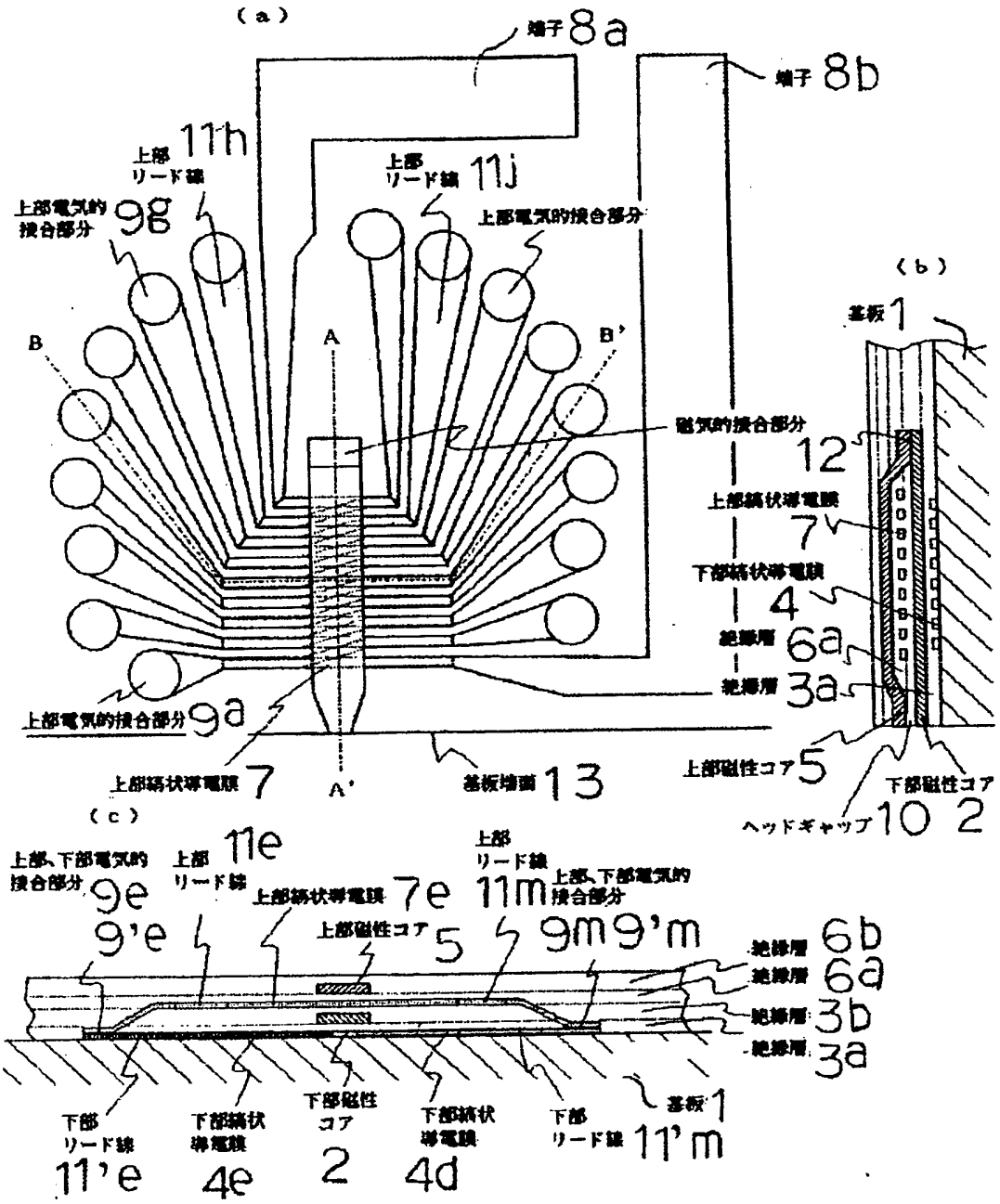
[Drawing 4]


14bh
スルーホール
下部電気的接合部分
9'g
下部電気的接合部分
9'k
スルーホール
14bl
磁気的接合部分
12
d
スルーホール
9'p
下部電気的接合部分
9'a
下部電気的接合部分
絶縁層
6a
基板端面
13
上部磁性コア
5
下部線状導電膜
4a

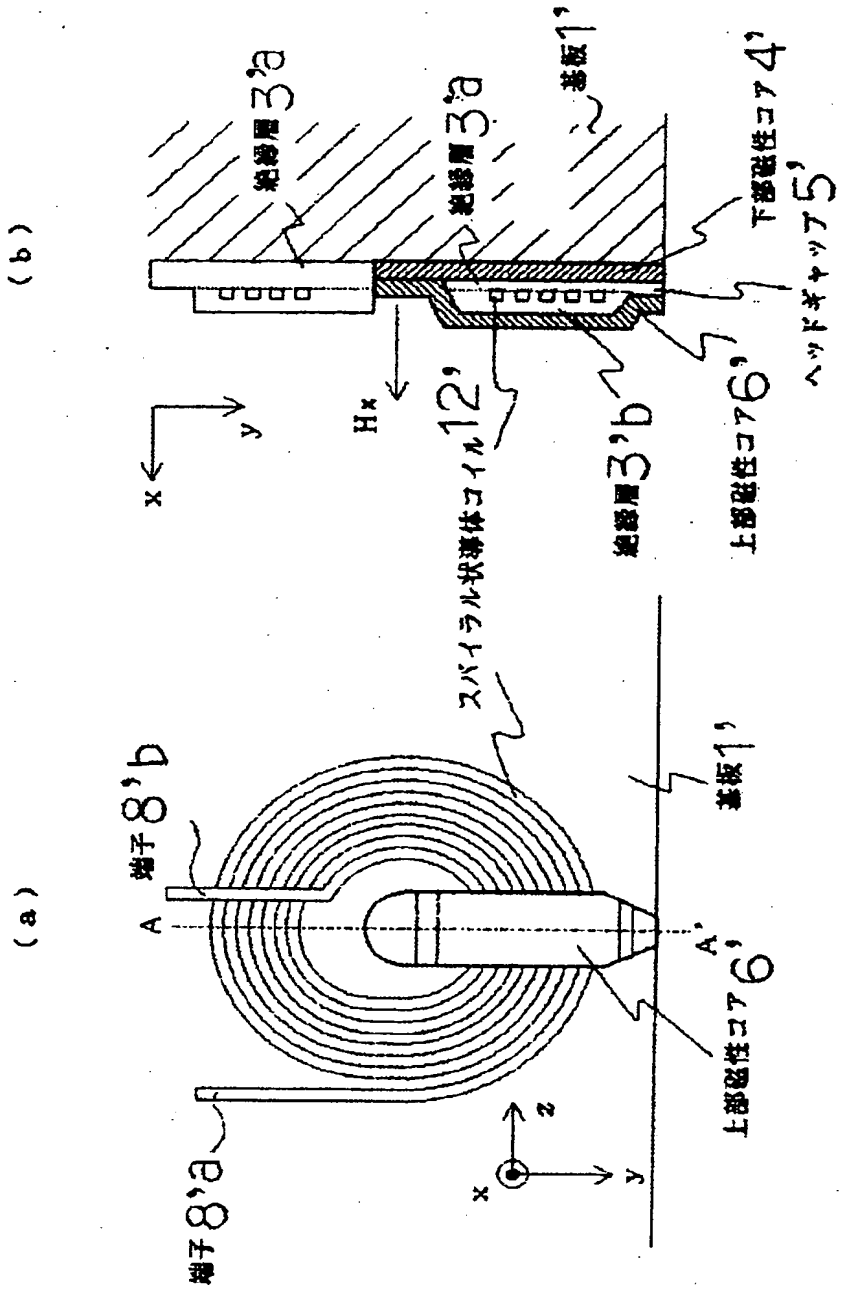
[Drawing 5]


端子 8a
端子 8b
11f
上部リード線
上部電気的接合部分 9g
スルーホール 14bj
上部電気的接合部分 9k
スルーホール
14bd
上部電気的接合部分
9p
上部電気的接合部分 9a
上部リード線 11p
基板端面 13
上部磁性コア 5
上部導体状導電膜 7a
絶縁層 6a

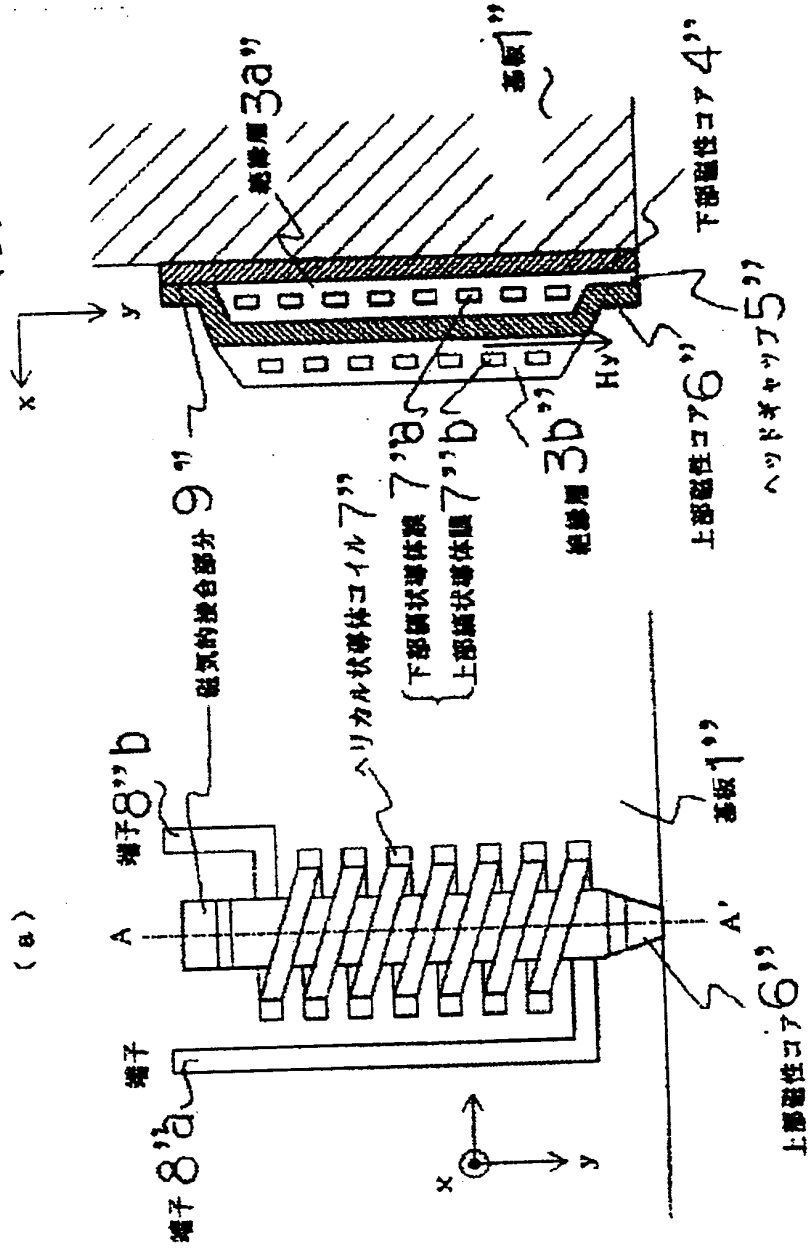
[Drawing 6]


(a)
端子 8a
端子 8b
上部リード線 11h
上部リード線 11j
上部電気的接合部分 9g
上部電気的接合部分
B
A
B'
磁気的接合部分
12
上部縞状導電膜
7
下部縞状導電膜
4
絶縁層 6a
絶縁層 3a
上部電気的接合部分 9a
上部縞状導電膜 7
A'
基板増膜 13
(b)
基板 1
上部磁性コア 5
下部磁性コア
ヘッドギャップ 10 2
(c)
上部、下部電気的接合部分 9e
上部リード線 11e
上部縞状導電膜 7e
上部リード線 11m
上部、下部電気的接合部分
9'e
上部磁性コア 5
9m 9'm
絶縁層 6b
絶縁層 6a
絶縁層 3b
絶縁層 3a
基板 1
下部リード線 11'e
下部縞状導電膜 4e
下部磁性コア 2
下部縞状導電膜 4d
下部リード線 11'm

[Drawing 7]


(b)
絶縁層3'a
絶縁層3'a
基板1'
下部磁性コア4'
ヘッドギャップ5'
Hx
y
x
スパイラル状導体コイル12'
絶縁層3'b
上部磁性コア6'
(a)
端子8'b
A
スパイラル状導体コイル
基板1'
A'
上部磁性コア6'
z
x
y
端子8'a

[Drawing 8]



[Translation done.]